Per la diffusione immediata: 14/04/2015 **IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO**

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INSTALLAZIONE DELLA PRIMA TECNOLOGIA DEL SUO GENERE RELATIVA A CHIP PER COMPUTER PRESSO IL CAMPUS NANOTECH DI ALBANY DEL SUNY POLY

Il SUNY Polytechnic e Nikon installeranno il primo strumento di litografia a immersione da 450 mm, finalizzato ad accelerare la produzione di chip per computer di ultimissima generazione

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'avvio dell'installazione del primo scanner a immersione del mondo da 450 mm, presso l'Albany NanoTech Complex del SUNY Polytechnic Institute. Questo strumento, che è il primo nel suo genere, è stato sviluppato da Nikon Corporation e accelererà lo sviluppo della prossima generazione di chip per computer, utilizzati in molteplici applicazioni destinate al consumo e al settore commerciale.

"New York è fiero di ospitare attività di ricerca tra le più sofisticate del pianeta in materia di chip per computer e, grazie alla presenza di migliaia di scienziati e ingegneri da Albany a Buffalo, stiamo procedendo a un livello di un'espansione dell'industria mai visto prima" ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Questi investimenti strategici in nanotecnologie, oltre a replicare gli effetti positivi ottenuti ad Albany in tutta la parte settentrionale dello Stato, hanno suscitato l'interesse di leader globali come Nikon, che stanno apportando fondi privati e opportunità occupazionali in New York".

Nell'installazione sarà impegnato un team formato da oltre 50 ingegneri provenienti dagli Stati Uniti e da ogni parte del mondo. La transizione ai 450 mm, guidata dal SUNY Polytechnic, rappresenta un balzo tecnologico per il settore dei semiconduttori. Data l'ampia gamma di applicazioni (telefoni cellulari, tablet, difesa, energia verde e molte altre), la dimensione 450 mm produrrà oltre il doppio dei chip lavorati rispetto agli odierni wafer da 300 mm, determinando costi inferiori e tecnologie molto più veloci e più affidabili riguardo ai chip per computer. Lo scanner è visualizzabile qui.

New York svolge un ruolo fondante per questa nuovissima generazione di tecnologia di chip per computer, facendo seguito all'annuncio espresso nel 2011 dal Governatore Cuomo, secondo cui i partner di G450C (di cui fanno parte Intel, IBM, GLOBALFOUNDRIES, TSMC e Samsung) avrebbero investito oltre 4,8 miliardi di dollari per costruire il primo wafer del mondo da 450 mm e l'ambiente di sviluppo dell'apparecchiatura presso il NanoTech Complex del SUNY Poly.

Toshikazu Umatate, Vice Presidente senior e Direttore generale di Nikon Corporation per l'Unità operativa Litografia per semiconduttori, ha riferito: "Il programma di Nikon sui 450 mm sta avanzando risolutamente e questa tappa entusiasmante è stata resa possibile dalla stretta collaborazione con molti nostri partner di tutto il consorzio. Nikon si impegna costantemente per innovare e progredire nel campo della litografia e per sostenere il settore affinché realizzi la produzione della prossima generazione di semiconduttori".

Il Dr. Alain E. Kaloyeros, Presidente e Amministratore delegato del SUNY Polytechnic Institute, ha sottolineato: "La consegna dello Scanner a immersione Nikon è una conquista dell'innovazione per lo Stato di New York e un'altra rilevantissima tappa cruciale nella tabella di marcia inerente alla tecnologia, formulata dal Governatore Cuomo per essere alla guida del settore globale dei semiconduttori verso lo sviluppo della prossima generazione di chip per computer. Lo Stato di New York consolida la sua posizione d'avanguardia nel campo dell'innovazione, facendo leva sulle competenze e le risorse di partner di classe internazionale come Nikon, mentre disegniamo il futuro della tecnologia relativa ai chip per computer e, al tempo stesso, conferiamo impulso allo sviluppo economico e alla creazione di occupazione".

A luglio 2013, il Governatore Cuomo ha annunciato una partnership da 350 milioni di dollari tra il College of Nanoscale Science and Engineering del SUNY Polytechnic e Nikon Corporation, per lo sviluppo della tecnologia di fotolitografia da 450 mm di prossima generazione. La fotolitografia è divenuta la fase critica che consente la produzione di transistor di dimensioni nanometriche, ovvero gli elementi fondamentali degli odierni chip per computer. Nikon e il SUNY Poly hanno lavorato senza soste per portare in linea lo scanner a immersione per litografia in meno di 12 mesi e hanno presentato i primi wafer del mondo da 450 mm interamente impressi a luglio 2014. Ora lo strumento a immersione Nikon si aggiunge alle esistenti infrastrutture da 450 mm presenti nel College of Nanoscale Science and Engineering del SUNY Poly, portando a oltre 700 milioni di dollari gli investimenti totali destinati ad apparecchiature per wafer da 450 mm presso l'Albany NanoTech Complex.

Informazioni su Nikon
Dal 1980, Nikon Corporation rivoluziona la litografia con prodotti e tecnologie innovativi. L'azienda è leader nel mondo per i sistemi di litografia per semiconduttori destinati al settore della produzione di microelettronica, con oltre 8.000 sistemi di litografia (semiconduttori) installati in tutto il mondo. Nikon propone una vasta gamma di sistemi di litografia per la produzione, destinati ai settori dei semiconduttori, dei display a schermo piatto (FPD) e delle testine magnetiche a film sottile (TFH). Nikon Precision Inc. fornisce servizi, formazione, applicazioni e assistenza tecnica, accanto alle attività di vendita e marketing per i sistemi di litografia Nikon nel Nord America. Per maggiori informazioni su Nikon, è possibile visitare il sito http://www.nikon.com.

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418